

Cesta De Limpieza Húmeda De Ptfе De Alta Pureza, Portaohetas Individual Para Grabado De Obleas, Portaplacas De Máscara De 4 Pulgadas Personalizable

Número de artículo: PL-CP66



Introducción

Las cestas de limpieza húmeda de PTFE de alta pureza ofrecen una resistencia química excepcional para el procesamiento de obleas semiconductoras. Estos portaohetas de grabado personalizables garantizan una limpieza por inmersión sin contaminantes y una manipulación segura de sustratos delicados en entornos industriales y de laboratorio exigentes. Contáctenos para soluciones de fluoropolímero a medida.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio principal
Limpieza de obleas semiconductoras	Inmersión de obleas de silicio en secuencias de limpieza RCA (SC-1 y SC-2) para eliminar contaminantes orgánicos y metálicos.	Evita la contaminación cruzada y garantiza un procesamiento de alta pureza.
Grabado químico húmedo	Grabado de precisión de películas delgadas (SiO ₂ , Si ₃ N ₄) mediante baños de ácido fluorhídrico o fosfórico a temperaturas elevadas.	Mantiene la integridad estructural en entornos de ácidos agresivos.
Procesamiento de placas de máscara	Manipulación y limpieza especializadas de fotomáscaras utilizadas en litografía para garantizar una transferencia de patrones sin defectos.	El ranurado de precisión evita daños por contacto en la superficie de la máscara.
Fabricación de células solares	Procesamiento a granel de obleas de silicio para texturizado y eliminación de vidrio de silicato de fósforo (PSG).	Alto rendimiento y durabilidad en ciclos de producción de gran volumen.
Preparación de vidrio conductor	Limpieza y preparación de vidrio recubierto de ITO/FTO para la fabricación de optoelectrónica y pantallas.	Los puntos de contacto mínimos evitan el rayado de capas conductoras delicadas.
Desarrollo de MEMS	Manipulación de sistemas microelectromecánicos multicapa durante procesos complejos de grabado de capas de sacrificio.	La inercia química garantiza que las microestructuras delicadas no se vean comprometidas.
I+D a escala de laboratorio	Tratamiento de sustratos en lotes pequeños en investigación académica e industrial para el desarrollo de nuevos materiales.	La personalización versátil permite adaptarse a formas y tamaños de sustrato no estándar.

Parámetro	Detalles de especificación (Modelo: PL-CP66)
Composición del material	PTFE (Politetrafluoroetileno) virgen de alta pureza al 100%
Temperatura máxima de funcionamiento	+260 °C (continua)
Temperatura mínima de funcionamiento	-200 °C
Compatibilidad química	Universal (pH 0-14); Resistente a HF, agua regia, solución de piraña
Tamaño estándar de sustrato	4 pulgadas (100 mm) - Personalizable para cualquier diámetro
Configuración de ranuras	Variantes de una o varias obleas disponibles

Aplicación	Descripción	Beneficio principal
Parámetro	Detalles de especificación (Modelo: PL-CP66)	
Profundidad/ancho de ranura	Totalmente personalizable según el grosor del sustrato y las necesidades de estabilidad	
Diseño de asas	Asas verticales fijas, desmontables o de tipo oscilante (personalizables)	
Método de fabricación	Mecanizado CNC de precisión (sin contaminación por moldeo)	
Acabado superficial	Acabado mecanizado de alta suavidad y baja porosidad	